PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

54-037697

(43)Date of publication of application: 20.03.1979

(51)Int.Cl.

G09F 9/30 G06K 15/18 // G02F 1/13

(21)Application number: 52-105549

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

30.08.1977

(72)Inventor: NONOMURA HIROSAKU

SHIMIZU KEIICHIRO

KISHI KOHEI WADA TOMIO

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY UNIT OF MATRIX TYPE

(57)Abstract:

PURPOSE: To establish excellent contrast, by sealing liquid crystal substance including polycolor element between the substrate and the entire surface transparent conductive substrate in which thin film transistors are provided on each cross point among a plural number of gate lines and the source lines perpendicular.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

			•
·			

(19日本国特許庁

公開特許公報

①特許出願公開

昭54—37697

Int. Cl. ²							
G 09 F	9/30						
G 06 K	15/18	1					
G 02 F	1/13						

識別記号

②日本分類 庁内整理番号
 101 E 5 7013─5C
 101 E 9 2116─5B
 104 G 0 7348─2H
 97(7) B 4

❸公開 昭和54年(1979) 3 月20日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 8 頁)

匈マトリックス型液晶表示装置

2)特

願 昭52—105549

②出

顧 昭52(1977)8月30日

⑫発 明 者 野々村啓作

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シヤープ株式会社内

同

清水桂一郎

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ株式会社内 **②**発明者 学幸平

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ株式会社内

同 和田富夫

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シヤープ株式会社内

⑪出 顧 人 シャープ株式会社

大阪市阿倍野区長池町22番22号

切代理 人 弁理士 福士愛彦

明 細 書

1. 発明の名称

マトリックス型液晶表示装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 複数個のゲート線及び前記ゲート線と直交する複数個のソース線を備え、その各交点に薄膜トランジスタ(TPT) アレイ を形成した基板を含し、前記 透明導電体を形成した基板を含し、前記 透明導電体間に被 晶材を挟持した構造のマトリックス形表示装置に於いて、上記液晶材として多色性色素を含む 液晶を用いる事を特長とするマトリックス型液 品表示装置。
- 8. 発明の詳細な説明

本発明は一般的には液晶ディスプレイ、特に薄膜トランジスタ(TFT)を用いたマトリックス 薬液晶表示装置の製造工程を簡略化し得る構造に 関するものである。

この種装置として特開昭 5 0 - 1 7 5 9 9 (日本 分類 1 0 1 B 5 、1 0 1 E 9 、1 0 4 G O、9 7(7) B 4)

がある。とれは第1図に示すように、行ドライバ R1~Rnへゲート電便を、残ドライパCl~Cn ヘソース電極を接続した FET トランジスタ20 を備え、ドレイン電極とアース間に液晶27を挿 入するとともに、ドレイン電極とゲート電極間に コンデンサ26を挿入して構成される。液晶間の 電気信号の印加とそとでの光学等性の変化の間に は遅延があるので、コンデンサ.2.6 は液晶間に信 号電圧が存る時間をその緩和時間以上に延長させ て液晶が応答できるようにするものであり、トラ ンジスタ20はしをい値を与える。 第1階の構成 にかいて、コンデンサ28はトランジスタ20の ドレインおよびゲート間に挿入され、コンデンサ 及び分離したアース面間の結合を不要にしている。 行発生器RIが正パルス、列発生器CIが負アフ ログパルスを発生すると、コンデンサC11 K印 加された電圧は列発生器C1からのアナログ電圧 8 0を放形 2 9 によつて決定される量だけ越える。 しかしながら波形28がアース電位に帰還すると (これによりトランジスタTiz はオフに左る。)。

特別 昭54-37697(2)

1

コンデンサ C11 間の電圧は列発生器 C1 により供給されるのと等しくなり、コンデンサ C11 は液晶セル L C11 と並列になる。従つてコンデンサ 2 6 はトランジスタのゲート及びドレイン間にあるとしても、フレームの大部分の間、液晶と並列であり、これにより液晶の応答時間を増加させる。

とのように、各エレメント毎にFET 及び浮遊 容量を設ける回路が述べられている。

その後、1972年に PBT 及び浮遊容量を蒸着 膜(Thin Film) を用いて形成する事により構成したマトリックス型液晶表示装置がウェスチン グハウス社(〒H社)から発表されている。

この仕様の詳細については『EEE Trans.ox Electron Denices ED-20 P895、1978、T.P. Brody et al、"A 6"×6" 20 l/inch Liquid Crystal Display Panel" に述べられているが、この発明をより選集するために、上記 Report に基づいて、その仕様及び動作原理を説明する。

第2図は、液晶の1エレメントを TFT 及び浮っ

べて非常に高く、その放電は徐々にしか行なわれず、ドレイン電極の電位(Vdrain)は式(2)に従って長い時間、高電位で保持される。

$$V drain = V_1 e^{-\frac{t}{T_2}}$$
 (2)

但し T2 = (Rarr //Rtc)(Ctc+Cs) この様子を各電極の電圧波形によつて第3図に示 すが、ソース電極1に加わる実効電圧が極めて小 さいにもからわらず、ドレイン電極に生じる実効 電圧、つまり液晶エレメントに印加される実効電 圧は非常に大きくなり、高コントラストの表示が 行なわれる訳である。

この時、より高いコントラストを得る為には、 式(1)(2)から考えて、 TFTのROFF/RON の比を 大きくすることはもち論、R_{LC} > ROFF だする と良い。これは、導電率の非常に低い被晶材を用 いれば良いことを示している。事実、W日社では この電界効果返の液晶材として、下記の混合比の (FBM) ツイステエド ネマテイック (TN) 液晶を用いて いる。

(PEBAB) 15%

遊客量を用いて駆動する回路を、第3図は、その 駆動被形を示す。とれらは1エレメントのみを示 したが、とれをX-Yに配置し、それを適当に結 線するととにより、マトリックス表示が可能にを る訳である。

第2図のソース電板1からV1電圧、ゲート電板8からV-1電圧を印加すると、TFT 6 は導通(ON)状態となり、ソース電板1からTFTのON抵抗(RoN)を通して被晶の容量(CLC)7と並列に接続されている浮遊容量(Cs)8 に充電が行なわれ、ドレイン電板5の電位(Vdrain)は式(1)に従つて変化する。

$$V drain = V_1 (1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}})$$
 (1).

次化ダート電極 8 を - V 2 化すると TFT 6 は 遺断 (OFF) 状態となり、容量 C LC 7 及び C s 8 化充電されている電荷は、 TFT の OFF 抵抗 (R OFF) 及び液晶の抵抗 (R LC)を通して放電を開 始するが、抵抗 R OFF 及び R LC が抵抗 R ON 化比

> (MBBA) 51% (EBBA) 34%

とのTN-FEM-LCは、第4図に示すよりにTNセル17の前後に2枚の偏光板18、14をクロスニコルに配する必要があり、従つて、TNセル17の一対の電極は、いずれも透明電板12、12′(例えば!n2O3)にする必要があつた。これをWH社では!n2O3 蒸着工程を省く意味から、金を500Å程度蒸着しているが、「n2O3の場合90%以上の透過率特性が得られるのに対し、金(500Å)では、70%以下と透過率が思く、良好な表示が得られなかつた。

次化との装置の薄膜トランジスタアレイ 基板を 形成する為のマスク (蒸着マスク又は、ホトマス ク) のパターンを示しながらその製作工程を説明 する。

工程1 コンデンサ(Cs)8の片面電振25を 第5図(a)のマスクを使用して、蒸着する。 この斜視図を第6図(a)に、断面図を第7図 (a)に示す。この電極は後に作る絵案の電極

特職 昭54-37697(3)

28と重立る位置にあり、In203、Sn02 等の透明電極材料を用いる。

工程2 ゲート電極8を第5図(10)のマスクを使用して蒸着する。電極材料としてはA1等を用いる。この電極の斜視図を第6図(11)に、断面図を第7図(12)に示す。

- 👔

- 工程 8 全面に絶縁膜 2 6 (例えば SiO2)を蒸着する。この膜の斜視図を第6図(c)に、断面図を第7図(c)に示す。この膜には次の3つの働きがある。
 - 1. ゲート電極 3 と工程 6 で蒸着するソース電板 2 7 の クロス部を電気的に絶録する。
 - 2. TFT 業子のゲート電極の絶縁膜 2.6 として用いる。
 - 8. コンデンサ(Cs) 8 の勝電体膜として 用いる。
- 工程 4 ゲート電徳 8 上の絶縁膜 2 6 の上に半導体膜 2 7 (例えば C d S, C d Se, T e)を 第 5 図(c) に示すマスクを使用して蒸着する。

との鍵の斜視図と断面図を第 6 図(d)と第 7 図(d)にそれぞれ示す。

- 工程 5 液晶セルの薄膜トランジスタ基板側の透明電極 2 8 (例えば In 2 O 3、Sn O 2) を 第 5 図(d)のマスタを使用して蒸着する。 この電極 2 8 の斜視図と断面図を第 6 図(e)と 第 7 図(e) に名々示す。
- 工程 6 ソース電框 2 7 とドレイン電極 2 9 として AI、 Au などを第 5 図(e)のマスクを使用して蒸粧する。この電極の形状を第 6 図(f)と第 7 図(f)に各々示す。

なお、W.H.社 では工程5の透明電低、工程6のソース電極及びドレイン電極化Au(500A程度では、半透明な酸化なる)を用い、同時化蒸着している。

以上がマトリックス変の液晶表示装置の片方の電極である薄膜トランジスタアレイ基板の製作工程である。もう一方の基板80は各般素化共通の全面透明導電膜8!を製作する。次にこの両方の電低上にS!O又はSiOz等の透明絶機膜38を

蒸着し、斜蒸着又はラビング等によつてTN配向 処理を行ない 2 枚の基板をシール材 8 2 で対止を し、これにTNILC 8 7 を注入する事によつて、 マトリックス型被晶セル 8 4 は完成する。これに 偏光板 8 5 、8 5 ′、 反射板 8 6 を組み合わせる ことによつて、第 8 図に示したマトリックス型液 晶表示装置となる。

以上の装置はTN-FBM-LCを用いた従来装置であるが、本発明は、これに代つて、多色性色素をゲストとして、ホストとしての液晶中へ溶解させた一般にゲストーホスト効果と呼ばれるモードを利用するところにある。

液晶のゲストホスト効果とは、Heilmeierと
2 anoni により、[App1 phys Lett、13 91
(1968)]報告された効果で多色性色素をゲスト
としホストとしての液晶中へ溶解させた系に電界
を印加することにより、いわゆる液晶分子の電界
変形効果を生じさせ、その結果として、多色性色
素の分子軸を回転させ、光吸収度を変調させ、表
示として用いるものである。そのセル構成及び光

学系は第9図に示す。

第9図(a)は一般的な反射型のゲストホスト効果型の核晶セルを示す。とれはセルの裏側に散乱被21があるが、これを第9図(b)のようにセルの一方の電板を光散乱する構造電極(例えば、磨り硝子24上に A1 電極28を蒸着する)にする事により、同じように良好なコントラストが得られる。

特閣 昭54-376 97(4

A 1 を蒸着しても良いし、TFT 来子及び X Y電 極を蒸着する以外の表示面のみを磨り硝子にしたい時は、ガラス面にフォトレジストを塗布した後 適当なマスクを用いて算光し、フツ酸(HF)等で、ガラス面を解かし凸凹面を作り、その上にAIを蒸着しても良い。第10回は後者の場合の断面 図を示す。

第10図において、88はA1等の同一材料で 出来でいるTFTのゲート電極及びコンデンサ Cs の片面電極を示し、89はA1等の同一材料で出 来ているソース電極、ドレイン電極及びLCセル のTFTナレイ基板側の電極を示す。

又、ガラス基板の代りに光を透過しないセラミンク差板を用いる事も可能であり、ガラス内のNaイオンが TPT の特性を劣化する危険性もあり、その意味から、セラミンク基板を用いることにより、より安定な TFT 未子表示装置の製作が可能となる。

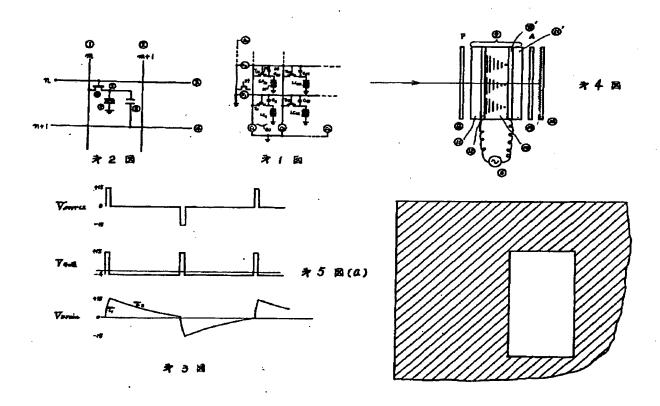
4. 図面の簡単な説明

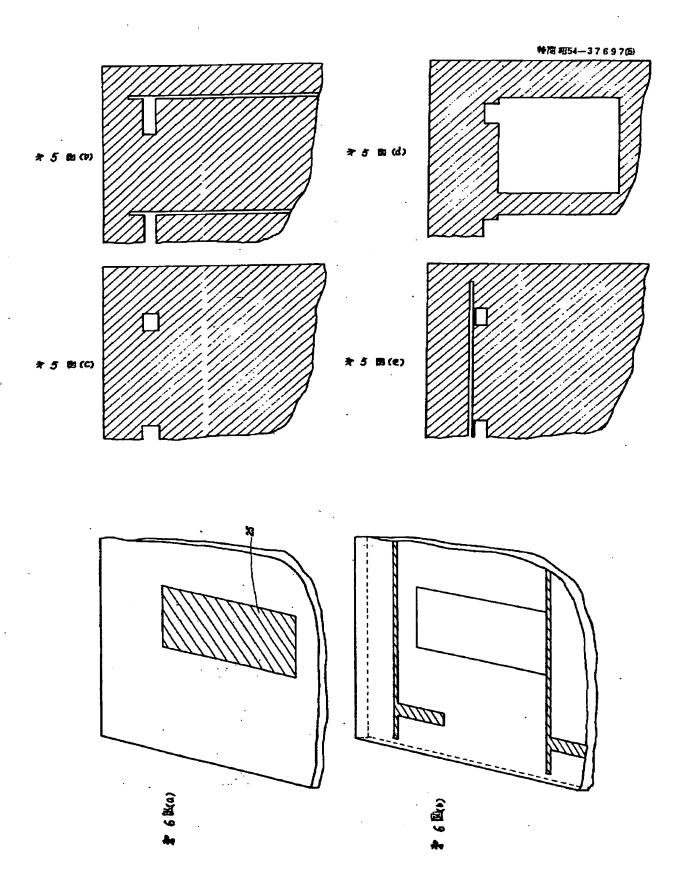
第1図は従来の TFT 及び浮遊容量を用いて収

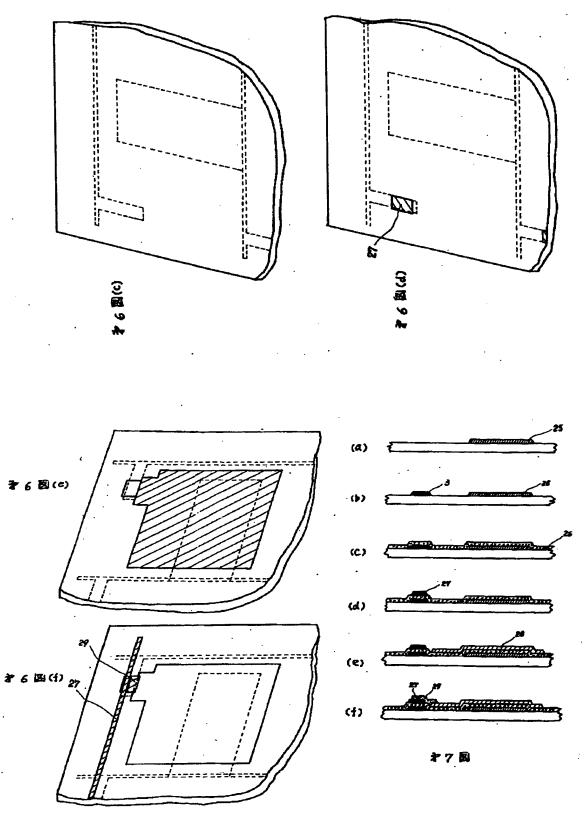
動するマトリックス型液晶表示装置の原動回路図、 第2回は同じく従来の蒸着膜を用いる型式のマト リックス型液晶表示装置の服動回路図、第8回は 第2回の回路の各電板の電圧液形図、第4回は反 材型TNLCセルの基本構造図、第5回はマトリ ックス型液晶表示装置を製造する際に用いられる 各工程のマスクの図、第6回は差板上に順次作ら れる膜を示す斜視図、第7回は同じく各工程での 断面図、第6回は従来のマトリックス型液晶表示 装置の断面図、第9回(a)(b)は反射型ゲストーホス ト液晶セルの基本構造図、第10回は本発明によ るマトリックス型液晶表示装置の断面図を示す。

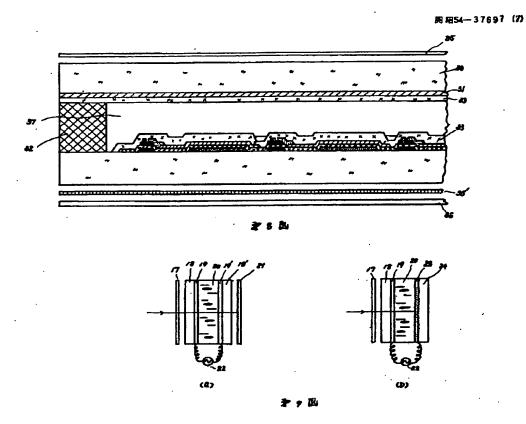
3 はゲート電板、2 5 はコンデンサ電低、2 6 は絶縁順、2 7 はソース電板、2 8 は透明電低、 2 9 はドレイン電板。

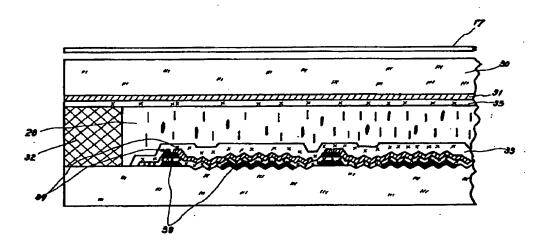
代理人 弁理士 福 士 愛 孝











710 国

- 特別 昭54-- 37697 (8)

手続補 正書

昭和 58年 8月八日

特許庁長官 館谷善二 酸

- 1. 事件の表示 特題昭 52~105549
- 2. 発明の名称 マトリンクス型液晶表示装置
- あ 括正をする者
 事件との関係 特許出職人
 住所 6045 大阪市内倍野区英地町22者22号名 称 (504) シャープ株式会社
 代表な 佐 伯 加
- 4.代 環 人 住所 49645 大阪市同倍野区長和町22番22号 レャープ株式会社内 氏名 分理士 (6238) 福 士 連絡先電筒 (第12年) 61 東東文地技術等
- 5. 植正命令の日付 自 発
- 6、 特正の対象
- . (1) 明制者の発明の詳細な説明の標
- 7. 補正の内着



- (i) 明転 第2頁第16行第16行に「アフログ」 とあるのを「アナログ」と訂正する。
- (2) 関第12質第2行に「用いる型式」とあるのを「用いる別の整式」と訂正する。

BL 上

代理人 弁理士 福 士 獎 穿